

5 ダイオキシン類関係

- 5- (1) **耐容一日摂取量** (TDI: ヒトが一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される1日体重1kg当たりのダイオキシン類摂取量)
ダイオキシン類の当面の耐容一日摂取量 (TDI) を4pg-TEQ/kg体重/日とする。

5- (2) 環境基準 (環境中のダイオキシン類濃度の基準)

大気 →0.6pg-TEQ/m³以下 (年平均値)
水質 →1pg-TEQ/ℓ以下 (年平均値)
底質 →150pg-TEQ/g以下
土壌 →1000pg-TEQ/g以下

5- (3) 排出基準 (排出ガス・排出水に係るダイオキシン類の規制基準)

① 排出ガス 特定施設及び排出基準値 (単位: ng-TEQ/m³N)

特定施設種類	施設規模 (焼却能力)	新設施設基準	既設施設基準	
			平成13年1月～ 平成14年11月	平成14年12月～
廃棄物焼却炉 (火床面積が0.5m ² 以上、 又は焼却能力が50 kg/h以 上)	4 t/h以上	0.1	80	1
	2 t/h-4t/h	1		5
	2 t/h未満	5		10
製鋼用電気炉		0.5	20	5
鉄鋼業焼結施設		0.1	2	1
亜鉛回収施設		1	40	10
アルミニウム合金 製造施設		1	20	5

注: 既に大気汚染防止法において新設の指定物質抑制基準が適用されていた廃棄物焼却炉 (火格子面積が2m²以上、又は焼却能力200kg/h以上) 及び製鋼用電気炉については、上表の新設施設の排出基準が適用されている。

② 排出水 特定施設及び排出基準値 (単位: pg-TEQ/ℓ)

特定施設種類	排出基準
・硫酸塩パルプ (クラフトパルプ) 又は亜硫酸パルプ (サルファイトパルプ) の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設 ・カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 ・硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 ・アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 ・担体付き触媒の製造 (塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。) の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設 ・塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設^{注1)} ・カプロラクタムの製造 (塩化ニトロシルを使用するものに限る。) の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設及び廃ガス洗浄施設 ・クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗浄施設及び廃ガス洗浄施設 ・4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、乾燥施設及び廃ガス洗浄施設 ・2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設及び廃ガス洗浄施設 ・ジオキサジンバイオレットの製造の用に供する施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設及び熱風乾燥施設 ・アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉に係る廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設^{注1)} ・亜鉛の回収 (製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。) の用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 ・担体付き触媒 (使用済みものに限る。) から金属の回収の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設 ・廃棄物焼却炉 (火床面積0.5 m²以上又は焼却能力50 kg/h以上) に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、汚水又は廃液を排出する灰の貯留施設^{注2)} ・廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設 ・フロン類の破壊の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 ・下水道終末処理施設 (水質基準対象施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る) ・水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設	10

※廃棄物の最終処分場の放流水に係る基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理基準を定める命令により10 pg-TEQ/ℓ。

※注1及び注2の既設施設は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行後3年間 (平成15年1月14日まで) 暫定基準値 (20 pg-TEQ/L及び50 pg-TEQ/ℓ) が適用されていた。

